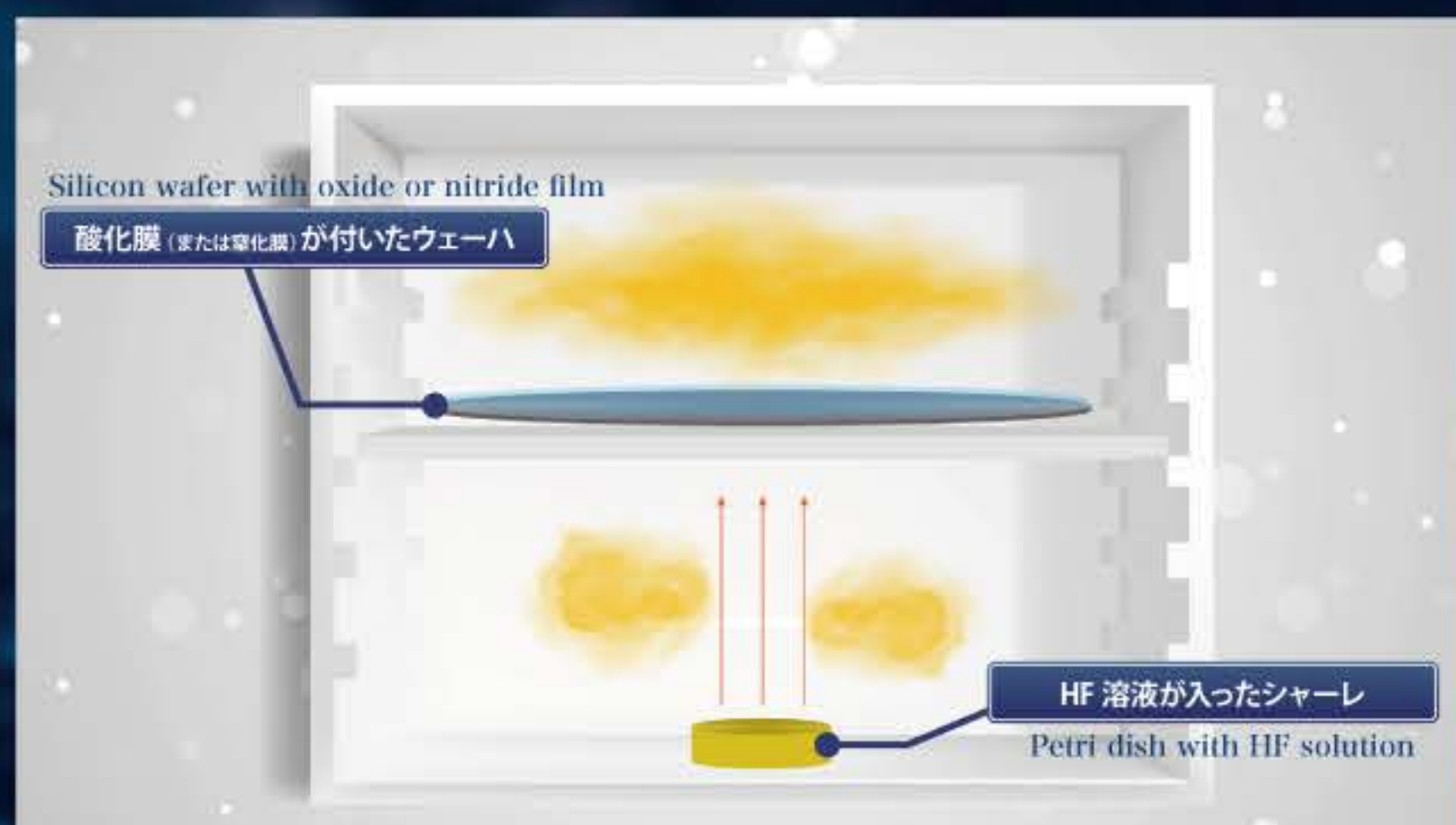
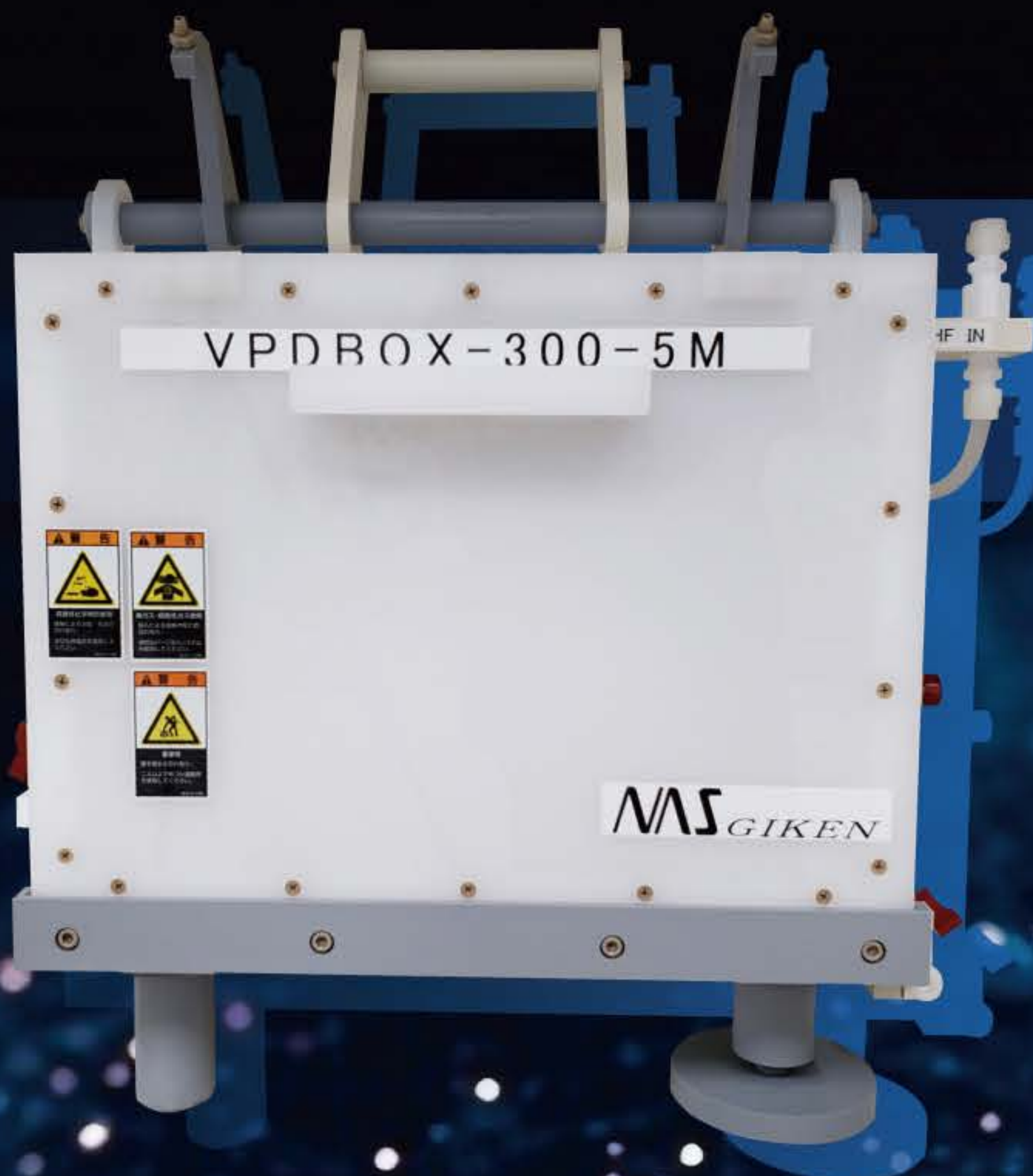


# VPD BOX

気相分解箱



## ポイント - Key Point

- 1** フッ酸液の自然気化を利用して、シリコンウェーハ表面の酸化膜・窒化膜を効率よく気相分解し、ウェーハ表面を疎水状態に保つ装置。  
Utilizing the natural evaporation of HF liquid, it can dissolve the oxide & nitride films on silicon wafer surfaces, keeping these surfaces hydrophobic.
- 2** SC シリーズとの併用により、作業効率が一層向上。  
Using VPD BOX with SC series further improves work efficiency.
- 3** クリーンドラフトの中に設置してご使用ください。  
Please install and use VPD BOX in a clean draft.

装置名 Device Name		VPD BOX-200-1M	VPD BOX-300-1M	VPD BOX-300-5M	VPD BOX-300-6M
最大処理枚数 Maximum Number of Wafers to be Processed		1 枚 1SH	1 枚 1SH	5 枚 5SH	6 枚 6SH
対応 ウェーハ サイズ Wafer Size	100mm	○	○	○	○
	125mm	○	○	○	○
	150mm	○	○	○	○
	200mm	○	○	○	○
	300mm	—	○	○	○
外形 (W×D×H) (mm) <sup>*1</sup> Size (W×D×H) (mm) <sup>*1</sup>		290×290×250	390×390×250	410×405×410	410×405×460
重量 Weight		6kg	8kg	15kg	18kg
使用場所 Recommended Environment		クリーンドラフト内 Inside Clean Draft			
外部資源 Utilities		N2 ガス (酸雰囲気パージ用) N2 (for Acid Atmosphere Purging)			

\*1: 突起物は含みません。 \*1: Does not include protrusions.